PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-005358

(43) Date of publication of application: 10.01.1997

(51)Int.CI.

G01R 1/073

H01L 21/66

(21)Application number : **07-149896**

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.06.1995

(72)Inventor: FUJIMAKI HITOSHI

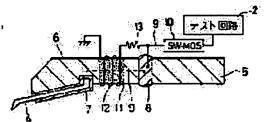
(54) PROBE CARD AND WAFER HANDLING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a probe card which can be used

commonly for any type of product.

CONSTITUTION: The probe card comprises a plurality of probe needles 4 touching respective electrodes of a circuit element, a plurality of needle receivers 6 provided, at a part in the longitudinal direction, with a shape memory alloy 11 for thermally displacing the probe needle 4 to touch the electrode, a heater 12 for heating the shape memory alloy 11, and a plurality of switching elements 10 for conducting the probe needle 4 and a test circuit 2 and operating the heater 12.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-5358

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01R 1/073 H01L 21/66 G01R 1/073

E

H01L 21/66

В

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平7-149896

平成7年(1995)6月16日

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 藤巻 仁

東京都小平市上水本町5丁目20番1号 株

式会社日立製作所半導体事業部内

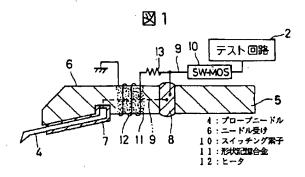
(74)代理人 弁理士 简井 大和

(54) 【発明の名称】 プロープカードおよびウエハハンドリング方法

(57)【要約】

【目的】 製品の種類に拘束されず、共通化を図ること のできるプローブカードを提供する。

【構成】 回路素子の各電極とそれぞれ接触する複数本のプローブニードル4と、それぞれのプローブニードル4が取り付けられ、長さ方向の一部に加熱によりプローブニードル4を電極に接触するように変位させる形状記憶合金11を有する複数のニードル受け6と、形状記憶合金11を加熱するヒータ12と、プローブニードル4とテスト回路2とを導通させるとともにヒータ12を作動させる複数のスイッチング素子10とを有するプローブカードである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体ウエハ上に形成された回路素子と 該回路素子の電気的特性を評価するテスト回路とを電気 的に接続するプローブカードであって、

前記回路素子の各電極とそれぞれ接触する複数本のプローブニードルと、

それぞれの前記プローブニードルが取り付けられ、長さ 方向の一部に加熱により前記プローブニードルを前記電 極に接触するように変位させる形状記憶合金を有する複 数のニードル受けと、

前記形状記憶合金を加熱するヒータと、

前記プローブニードルと前記テスト回路とを導通させる とともに前記ヒータを作動させる複数のスイッチング手 段とを有することを特徴とするプローブカード。

【請求項2】 請求項1記載のプローブカードにおいて、このプローブカードと前記半導体ウエハは相対的に平行移動可能とされていることを特徴とするプローブカード。

【請求項3】 請求項2記載のプローブカードにおいて、このプローブカードは1枚の半導体ウエハについて 20 複数設けられていることを特徴とするプローブカード。 【請求項4】 請求項2または3記載のプローブカードを用いて前記半導体ウエハ上に形成された回路素子の電気的特性を評価するウエハハンドリング方法であって、前記テスト回路との電気的導通をとる前記電極の電極座標を入力する工程と、

入力された前記電極座標から前記電極と接触する前記プローブニードルを選択する工程と、

前記プローブカードを前記半導体ウエハの所定位置に移動させる工程と、

選択された前記プローブニードルに対応する前記スイッチング手段をオンして前記ヒータで前記形状記憶合金を加熱し、前記プローブニードルのうちの一部を選択的に前記電極に接触させて前記回路素子と前記テスト回路とを電気的に接続する工程とを有することを特徴とするウエハハンドリング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体ウエハ上に形成された様々な種類の回路素子の電気的特性を評価する際に 40 使用されるプローブカードに適用して有効な技術に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体ウエハ上に形成された回路素子と テスト回路との導通をとり、所定のテスト信号の入出力 や電源の供給を行って回路素子の電気的特性を評価する ウエハプローバにあっては、両者を電気的に接続するた めに、回路素子に形成された電極の位置に対応したプロ ーブニードルが多数設けられたプローブカードが用いら れている。 【0003】なお、ウエハプローバを詳しく記載している例としては、たとえば、工業調査会発行、「電子材料別冊・超LSI製造、試験装置ガイドブック」1994年版(1993年11月20日発行)、P193~P197がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】回路素子とテスト回路との電気的な接続を行うプローブカードでは、評価対象の製品に合わせたニードル配置がなされていることから、今日のように多品種の製品が製造される状況においては、必要になるプローブカードは多種にわたっている。また、一仕様につき複数枚の予備用のプローブカードを保有しなければならず、その結果、プローブカードは多種、大量にストックされている。

【0005】これではプローブカードの管理工数が増大するのみならず、製品ごとにプローブカードを交換する必要があるのでスループットが悪化することになる。 【0006】そこで、本発明の目的は、製品の種類に拘束されることなく共通のプローブカードを使用すること

20 【0007】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかにな るであろう。

のできる技術を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 次のとおりである。

【0009】すなわち、本発明によるプローブカードは、回路素子の各電極とそれぞれ接触する複数本のプローブニードルと、それぞれのプローブニードルが取り付30 けられ、長さ方向の一部に加熱によりプローブニードルを電極に接触するように変位させる形状記憶合金を有する複数のニードル受けと、形状記憶合金を加熱するヒータと、プローブニードルとテスト回路とを導通させるとともにヒータを作動させる複数のスイッチング手段とを有するものある。

【0010】この場合において、プローブカードと半導体ウエハとは相対的に平行移動可能とされていることが望ましい。また、このプローブカードは1枚の半導体ウエハについて複数設けられていてもよい。

40 【0011】本発明によるウエハハンドリング方法は、このようなプローブカードを用いて半導体ウエハ上に形成された回路素子の電気的特性を評価するものであり、テスト回路との電気的導通をとる電極の電極座標を入力する工程と、入力された電極座標から電極と接触するプローブニードルを選択する工程と、プローブカードを半導体ウエハの所定位置に移動させる工程と、選択されたプローブニードルに対応するスイッチング手段をオンしてヒータで形状記憶合金を加熱し、プローブニードルのうちの一部を選択的に電極に接触させて回路素子とテスト回路とを電気的に接続する工程とを有するものであ

11/21/2003, EAST Version: 1.4.1

る。

[0012]

【作用】上記した手段によれば、スイッチング手段のオ ンによるヒータの作動で形状記憶合金が加熱されてプロ ーブニードルが電極に接触する構成を採用したので、テ スト対象の半導体ウエハに対応したプローブニードルを 選択し、スイッチング手段をオンして選択的にプローブ ニードルを電極に接触させるようにすることが可能にな る。

【0013】これにより、製品の種類に拘束されること 10 なくプローブカードの共通化を図ることができる。

[0014]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 に説明する.

【0015】図1は本発明の一実施例であるプローブカ ードを示す断面図、図2は図1の正面図、図3は図1の プローブカードの電気的構成を示す概略図、図4は図1 のプローブカードにおけるプローブニードルの動作を示 す説明図、図5は図1のプローブカードの半導体ウエハ に対する動きを示す説明図、図6は図1のプローブカー 20 ドによるウエハソハンドリング方法を示すフローチャート である。

【0016】図示する本実施例のプローブカードは、い わゆるウエハプロセス終了後、半導体ウエハ1(図4、 図5)上に形成された回路素子とこの回路素子の電気的 特性を評価するためのテスト回路2とを電気的に接続す るためのもので、図1の左側に表された先端部には回路 素子の電極3(図4)と接触してテスト回路2とを導通 させるプローブニードル4が設けられている。このプロ ーブニードル4は台座5に支持されたニードル受け6に 30 取り付けられており、プローブカード全体としては、ニ ードル受け6を一括して支持する1つの台座5に沿って プローブニードル4が複数本配列された形状となってい る(図5参照)。

【0017】たとえばチタンなどの導電性の金属よりな り、図2に示すように先端が尖ったプローブニードル4 ははんだ7によりニードル受け6に取り付けられてい る。一方、ニードル受け6もまた、はんだ8により台座 5に取り付けられており、プローブニードル4から延び た配線 9 とテスト回路 2 からスイッチング手段であるス 40 イッチング素子(以下「SW素子」という。)10を経 由して延びた配線9とはこのはんだ8によって導通がと られている。なお、台座5とニードル受け6とははんだ 8に替えてコネクタで接続するようにしてもよい。

【0018】ニードル受け6の長さ方向の一部には形状 記憶合金11が用いられている。この形状記憶合金11 はたとえば銅ー亜鉛ーアルミニウムのマルメム合金から なり、該合金を加熱して原子の結晶構造を母相の構造配 列にし、次に、急冷してマルテンサイトの結晶構造にす るものである。これにより、常温ではプローブニードル 50 て、複数のプローブニードル4のうちから電極3と接触

4を持ち上げた状態にあるニードル受け6が、形状記憶 合金11が加熱されてマルテンサイトが母相に逆変態す ると、プローブニードル4を下方に変位させるような原 子集団の規則正しい変位が生じて該プローブニードル4

は電極3に接触するようになる(図4参照)。

【0019】このような形状記憶合金11を加熱するた め、SW素子10によるテスト回路2とプローブニード ル4の導通と連動して作動するヒータ12が該形状記憶 合金11に巻き付けられている。したがって、SW素子 10がオンするとヒータ12による形状記憶合金11の 加熱も同時に行われる。なお、ヒータ12側は接地電位 とされるとともに、プローブニードル4よりもヒータ1 2の方に多くの電流が流れないように、ヒータ12とS W素子10との間には抵抗13が設けられている。

【0020】図3に示すように、SW素子10はたとえ ばMOSFETから構成されており、ゲートにテスト回 路2からとられた電源電圧VDDを印加するとテスト回路 2とプローブニードル4とが導通され、同時にヒータ1 2が作動して図1に示す形状記憶合金11が加熱され る。なお、スイッチング手段としてのSW素子10はM OSFET以外のもの、たとえばバイポーラトランジス タや機械的なスイッチを適用してもよい。

【0021】形状記憶合金11が加熱されていないとき には、図4(a)に示すように、プローブニードル4は ニードル受け6に持ち上げられた状態で電極3とは非接 触となっている。そして、ヒータ12によりこの形状記 憶合金11が加熱されると、図4(b)に示すように、 ニードル受け6が下方に傾斜して行きプローブニードル 4が電極に接触する。つまり、テスト回路2と電極3と がプローブニードル4を介して電気的に接続される。

【0022】図5に示すように、1枚のプローブカード には、直線状に形成された台座5の長さ方向に沿ってプ ローブニードル4が複数本配列されている。そして、本 実施例の場合には、外側および内側の四角形をそれぞれ 形作るようにして合計8枚のプローブカードが設けられ ている。各プローブカードは半導体ウエハ1に対して平 行移動可能になっており、したがって、これらを所望の 位置に移動させることによってプローブニードル4は接 触対象となる電極3の直上に位置することになる。な お、1枚の半導体ウエハ1に対して設けられるプローブ

カードは1枚、あるいは2枚以上であってもよく、ま た、一方向にのみ平行移動ができるようになっていても よい。さらに、プローブカードを固定して半導体ウエハ 1 側を移動するようにしてもよい。

【0023】このようなプローブカードを用いたウエハ ハンドリング方法を図6に基づいて説明する。

【0024】まず、ステップS1 において、所定の入力 装置によってテスト回路2との電気的導通をとる電極3 の電極座標 (X, Y)を入力すると、ステップS2 に

20

するプローブニードル4が選択される。

【0025】プローブニードル4が選択されると、ステ ップS3 にて、プローブカードが半導体ウエハ1の所定 位置に移動し、ステップS4 にて、選択されたプローブ ニードル4に対応するSW素子10がオンされる。これ により、一部のプローブニードル4がアクティブに遷移 するとともに、ヒータ12による形状記憶合金11の加 熱により該プローブニードル4は図4(a)から図4

(b) に示す状態に移行して電極3に接触することにな る。そして、半導体ウエハ1に形成された回路素子とテ 10 うにしてもよい。 スト回路2とが電気的に接続される。なお、選択されて いないプローブニードル4に対応するSW素子10はオ フのままなので、該プローブニードル4は図4(a)の 状態に保持されて電極3との間は一定の間隔に保たれ

【0026】そして、ステップS5 においてテストを開 始し、所定のテスト信号の入出力や電源の供給を行って 回路素子の電気的特性の評価を行う。 ステップ S6 でテ ストが終了すると、ステップS7でSW素子10がオフ され、一連のウエハハンドリングが終了する。

【0027】続いて、異なる品種の半導体ウエハ1のテ ストを行う場合には、ステップS1において、該半導体 ウエハ1の電極3に対応した固有の電極座標(X,Y) を入力する。これにより、ステップS2 にて、複数のプ ローブニードル4のうちから前回とは異なるプローブニ ードル4が新たに選択される。

【0028】次に、ステップ S3 にてプローブカードが 移動し、ステップS4 にて、新たに選択されたプローブ ニードル4に対応するSW素子10がオンされてプロー ブニードル4が電極3に接触し、回路素子とテスト回路 30 2とが接続される。以降は前述の場合と同様に、ステッ プS5 でテスト開始、ステップS6 でテスト終了、ステ ップS7 でSW紫子10オフとなる。

【〇〇29】このように、本実施例によるプローブカー ドによれば、SW素子10のオンによるヒータ12の作 動で形状記憶合金11が加熱されてプローブニードル4 が電極3に接触するようになっているので、テスト対象 の半導体ウエハ1に対応したプローブニードル4を選択 し、このプローブニードル4をアクティブにするSW素 子10をオンして選択的にプローブニードル4を電極3 40 に接触させるようにすることができ、製品の種類に拘束 されることなくプローブカードの共通化を図ることが可 能になる。

【〇〇30】これにより、プローブカードの保有枚数を 大幅に削減することができるのみならず、製品ごとにプ ローブカードを交換する必要がなくなりスループットの 向上を図ることもできる。

【〇〇31】以上、本発明者によってなされた発明を実 施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 50

で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0032】たとえば、本実施例においては、プローブ カードを移動してからSW素子10をオンしてプローブ ニードル4が電極に接触するようになっているが、プロ ーブカードを半導体ウエハ1に対して接近離反可能と し、離反状態においてSW素子10をオンして予めプロ ープニードル4を選択的に下降させておき、プローブカ ードを半導体ウエハ1の所定位置に移動してこれを接近 させることでプローブニードル4が電極3に接触するよ

[0033]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以 下のとおりである。

【0034】(1).すなわち、本発明のプローブカードに よる技術によれば、スイッチング手段のオンによるヒー タの作動で形状記憶合金が加熱されてプローブニードル が電極に接触する構成を採用したので、テスト対象の半 導体ウエハに対応したプローブニードルを選択し、スイ ッチング手段をオンして選択的にプローブニードルを電 極に接触させるようにすることがでる。したがって、製 品の種類に拘束されることなくプローブカードの共通化 を図ることが可能になる。

【0035】(2).これにより、プローブカードの保有枚 数を大幅に削減することができ、管理工数の低減を図る ことができる。

【0036】(3).また、製品ごとにプローブカードを交 換する必要がなくなるので、スループットの向上を図る ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例によるプローブカードを示す 断面図である。

【図2】図1の正面図である。

【図3】図1のプローブカードの電気的構成を示す概略 図である。

【図4】図1のプローブカードにおけるプローブニード ルの動作を示す説明図であり、(a)はプローブニード ルが電極に接触していない状態を、(b)はプローブニ ードルが電極に接触した状態をそれぞれ示す。

【図5】図1のプローブカードの半導体ウエハに対する 動きを示す説明図である。

【図6】図1のプローブカードによるウエハハンドリン グ方法を示すフローチャートである。

【符号の説明】

- 半導体ウエハ 1
- 2 テスト回路
- 3 電極
- プローブニードル 4
- 台座
- ニードル受け

END

PAT-NO:

JP409005358A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 09005358 A

TITLE:

PROBE CARD AND WAFER HANDLING METHOD

PUBN-DATE:

January 10, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUJIMAKI, HITOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP07149896

APPL-DATE: June 16, 1995

INT-CL (IPC): G01R001/073, H01L021/66

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a probe card which can be used commonly for any type of product.

CONSTITUTION: The probe card comprises a plurality of probe needles 4 touching respective electrodes of a circuit element, a plurality of needle receivers 6 provided, at a part in the longitudinal direction, with a shape memory alloy 11 for thermally displacing the probe needle 4 to touch the electrode, a heater 12 for heating the shape memory alloy 11, and a plurality of switching elements 10 for conducting the probe needle 4 and a test circuit 2 and operating the heater 12.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO